

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012 年 1 月 12 日(12.01.2012)

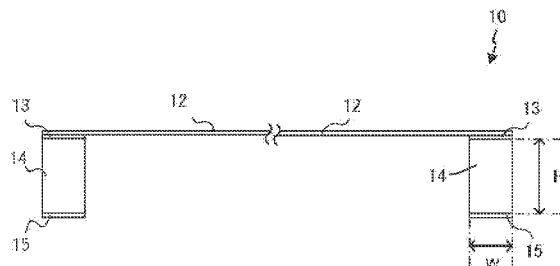
(10) 国際公開番号
WO 2012/004951 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 1/14 (2006.01) *C09J 153/00* (2006.01)
C09J 133/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/003706
- (22) 国際出願日: 2011 年 6 月 29 日(29.06.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-156864 2010 年 7 月 9 日(09.07.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井化学株式会社(Mitsui Chemicals, Inc.) [JP/JP]; 〒1057117 東京都港区東新橋 1 丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 種市 大樹 (TANEICHI, Daiki), 河関 孝志 (KOZEKI, Takashi), 小出 哲裕(KOIDE, Akihiro).
- (74) 代理人: 鷺田 公一(WASHIDA, Kimihito); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: PELLICLE AND MASK ADHESIVE AGENT FOR USE IN SAME

(54) 発明の名称: ペリクル及びそれに用いるマスク接着剤

【図1】



(57) Abstract: The purpose is to provide a pellicle which has a mask adhesive layer that can be plastic-deformed readily particularly at a temperature at which exposure to light is carried out, rarely remains an adhesive agent upon the removal of the mask adhesive layer from a mask and has good handling properties, and which can prevent the position gap of a pattern. For achieving the purpose, a pellicle (10) is provided, which comprises a pellicle frame (14), a pellicle film (12) and a mask adhesive layer (15) containing a mask adhesive agent. The mask adhesive agent comprises 100 parts by mass of a thermoplastic elastomer (A) having a tan δ peak temperature of -20 to 30°C and 20 to 150 parts by mass of an adhesiveness-imparting resin (B), wherein the thermoplastic elastomer (A) is at least one component selected from the group consisting of a styrene thermoplastic elastomer, a (meth)acrylic acid ester thermoplastic elastomer and an olefin thermoplastic elastomer, and the mask adhesive agent has a tan δ peak temperature of -10 to 30°C.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2012/004951 A1